



Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 17. IV. 1963 (P 101 318)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 2 0 KWIET 1965

Kl. 33 c 9/01

MKP A 45 d 27/04

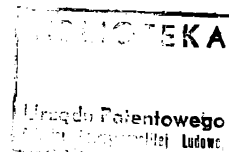
UKD

Współtwórcy wynalazku:

i
właściciele patentu:

Franciszek Curzytek, Gdańsk (Polska), Jan Curzytek,
Gdańsk (Polska)

Przyrząd do wytwarzania piany



1

Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do wytwarzania piany przez zasysanie cieczy do zasobnika i wytłaczanie jej, służący jednocześnie do rozprowadzania piany przed goleniem.

Znany sposób wytwarzania piany, stosowany powszechnie dla zmiękczenia zarostu przed goleniem, polega na rozprowadzaniu cieczy za pomocą pędzla.

Znane też są aparaty ciśnieniowe, wytwarzające pianę przy wydmychaniu odpowiednich cieczy poprzez dyszę.

Przyrząd do wytwarzania piany według wynalazku umożliwia wytwarzanie piany z kremu do golenia lub proszku w sposób bardzo prosty i skuteczny, a ponadto jest wygodny, estetyczny i tani. W porównaniu ze znanymi sposobami, sposób według wynalazku umożliwia szybsze uzyskanie zmiękczenia zarostu, gdyż szybciej wytworzona zostaje piana. Przyrząd według wynalazku w stosunku do znanych przyrządów jest łatwy do odkażania i dezynfekcji po użyciu, nie traci swych właściwości z biegiem czasu, w szczególności praktycznie nie ściera się. Przyrząd umożliwia równomierne rozprowadzenie piany po zarostie i jednocześnie mechanicznie przygotowuje zarost do golenia. Ciecz kolejno zasysa się i wytłacza i podczas intensywnego ruchu wytworzona zostaje piana, gęstniejąca przy powtarzaniu cykli.

Na rysunku fig. 1 przedstawia przyrząd do wytwarzania piany w widoku w kierunku jego osi

2

podłużnej, fig. 2 — przyrząd w przekroju wzdłuż linii A—A na fig. 1, a fig. 3 — przyrząd w przekroju wzdłuż linii B—B na fig. 1.

Przyrząd według wynalazku składa się z prostokątnej płytki *p* z wgłębieniem z wewnątrz nagwintowanym, w którym zamocowana jest wewnętrzna tulejka *w* wchodząca przesuwnie w wewnętrzną tulejkę *t*, wyposażoną w szyjkę *s*, osadzoną w otworze szyjki balonika *b*. Robocza zewnętrzna strona płytki *p* ma poprzeczne profilowane rowki *r*. Rowki *r* tworzą linie kilkakrotnie łamane, do siebie równoległe. Głębokość rowków *r* jest większa od grubości płytki *p* w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie *z*, dzięki czemu we wgłębieniu *z* powstają podłużne otwory, umożliwiające zasysanie i wytłaczanie piany lub cieczy. Kąty odcinków łamanej linii rowków *r* są zawarte pomiędzy 170 i 190°. Wzajemna odległość rowków *r* jest rzędu 1–3 mm.

Wewnętrzna tulejka *w* jest jednocześnie dozownikiem kremu do golenia lub płynnego mydła, a balonik *b* — zasobnikiem wytworzonej piany. Odmiana przyrządu — nie uwidoczniiona na rysunku — ma na roboczej stronie płytki nałóżone profilowane druciki, tworzące linie łamane, podobnie jak rowki *r* w przyrządzie.

Zastrzeżenia patentowe

1. Przyrząd do wytwarzania piany z mydła znamienny tym, że jest wyposażony w prostokątną

plytkę (p) z wewnątrznie nagwintowanym wgłębieniem (z), w którym zamocowana jest wewnętrzna tulejka (w), wchodząca przesuwnie w zewnętrzną tulejkę (t), wyposażoną w szyjkę (s) osadzoną w otworze szyjki balonika (b).

2. Przyrząd według zastrz. 1 znamieny tym, że płytkę (p) zawiera na zewnętrznej stronie poprzeczne profilowane rowki (r), tworzące wzajemnie do siebie równoległe, kilkakrotnie łamane linie, przy czym głębokość rowków (r) 10

jest większa od grubości płytki (p) w miejscu, w którym znajduje się wgłębienie (z).

3. Przyrząd według zastrz. 1 i 2 znamieny tym, że kąty odcinków linii łamanej są zawarte pomiędzy 170 i 190°, a wzajemna odległość rowków (r) jest rzędu 1—3 mm.
4. Odmiana przyrządu według zastrz. 1—3 znamieny tym, że na roboczej, zewnętrznej stronie płytki nałożone są profilowane druciki, tworząc linie łamane.

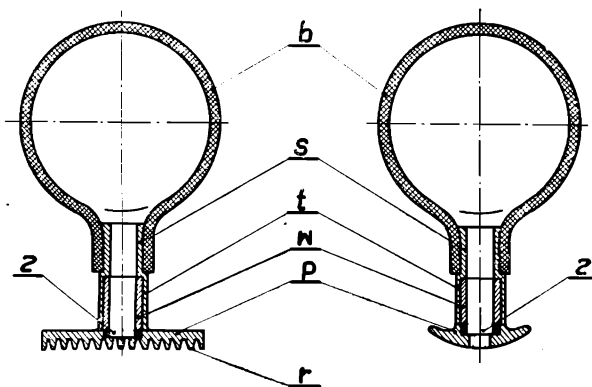
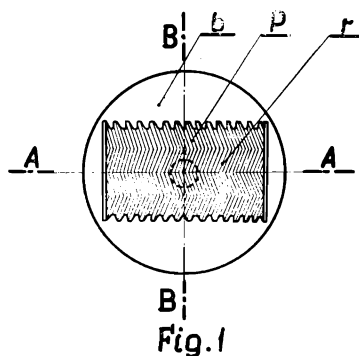


Fig. 2

Fig. 3